

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成22年12月9日 (2010.12.9)

【公開番号】特開2010-240550(P2010-240550A)

【公開日】平成22年10月28日 (2010.10.28)

【年通号数】公開・登録公報2010-043

【出願番号】特願2009-90925(P2009-90925)

【国際特許分類】

B 0 5 C 11/10 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

B 0 5 C 5/02 (2006.01)

G 0 3 F 7/16 (2006.01)

【F I】

B 0 5 C 11/10

H 0 1 L 21/30 5 6 4 Z

B 0 5 C 5/02

G 0 3 F 7/16 5 0 1

H 0 1 L 21/30 5 6 9 D

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月21日 (2010.10.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

請求項 1 に係る発明は、基板に所定の処理液を塗布する基板処理装置であって、略水平な第 1 方向に沿って搬送される前記基板の上方に設置され、前記処理液を吐出可能であって、前記第 1 方向に直交する略水平な第 2 方向に沿って延びたノズルと、前記第 2 方向に沿って延び、外周面に前記ノズルから前記処理液を吐出させることにより、前記ノズルの先端部の前記処理液を所定の状態に整える予備吐出のためのローラと、前記第 2 方向に沿って延びており、前記ローラを収容する筐体と、洗浄液で前記ノズルの洗浄を行うノズル洗浄機構と、を備え、前記ノズルからの吐出液と、前記ノズル洗浄機構からの排出液とが、共通の前記筐体内に貯留されることを特徴とする。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 1】

請求項 2 に係る発明は、請求項 1 に記載された基板処理装置であって、前記筐体と連結されて、前記ノズル洗浄機構をその上方に待機させる待機バットと、前記ノズル洗浄機構の前記待機バット内の液体を前記筐体内に導入させる配管と、をさらに備えることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 3

【補正方法】変更

## 【補正の内容】

## 【００１３】

請求項４に係る発明は、請求項２に記載された基板処理装置であって、前記筐体と前記ノズル洗浄機構と前記待機バットとのうち、前記筐体のみに、廃液配管と排気配管とが設置されていることを特徴とする。

## 【手続補正４】

## 【補正対象書類名】明細書

## 【補正対象項目名】００１８

## 【補正方法】変更

## 【補正の内容】

## 【００１８】

請求項９に係る発明は、請求項１ないし８のいずれかに記載された基板処理装置であって、前記筐体の内部側面に設置され、前記筐体内に洗浄液を供給する洗浄液供給手段と、前記筐体内の液面高さを検知する液面検知手段と、前記液面検知手段によって検知された液面レベルが所定の基準レベルを下回ったときに、前記洗浄液供給手段から前記筐体内に洗浄液を供給させる洗浄液供給制御手段と、をさらに備える。

## 【手続補正５】

## 【補正対象書類名】特許請求の範囲

## 【補正対象項目名】全文

## 【補正方法】変更

## 【補正の内容】

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項１】

基板に所定の処理液を塗布する基板処理装置であって、  
略水平な第１方向に沿って搬送される前記基板の上方に設置され、前記処理液を吐出可能であって、前記第１方向に直交する略水平な第２方向に沿って延びたノズルと、  
前記第２方向に沿って延び、外周面に前記ノズルから前記処理液を吐出させることにより、前記ノズルの先端部の前記処理液を所定の状態に整える予備吐出のためのローラと、  
前記第２方向に沿って延びており、前記ローラを収容する筐体と、  
洗浄液で前記ノズルの洗浄を行うノズル洗浄機構と、を備え、  
前記ノズルからの吐出液と、前記ノズル洗浄機構からの排出液とが、共通の前記筐体内に貯留されることを特徴とする基板処理装置。

## 【請求項２】

請求項１に記載された基板処理装置であって、  
前記筐体と連結されて、前記ノズル洗浄機構をその上方に待機させる待機バットと、  
前記ノズル洗浄機構の前記待機バット内の液体を前記筐体内に導入させる配管と、  
をさらに備えることを特徴とする基板処理装置。

## 【請求項３】

請求項１に記載された基板処理装置であって、  
前記筐体と前記ノズル洗浄機構とのうち、前記筐体のみに、廃液配管および排気配管が設置されていることを特徴とする基板処理装置。

## 【請求項４】

請求項２に記載された基板処理装置であって、  
前記筐体と前記ノズル洗浄機構と前記待機バットとのうち、前記筐体のみに、廃液配管と排気配管とが設置されていることを特徴とする基板処理装置。

## 【請求項５】

請求項１ないし４のいずれかに記載された基板処理装置であって、  
前記ノズル洗浄機構から前記ノズルの先端部に向けて吐出された洗浄液と、  
基板への処理液の吐出前に前記ノズルから前記ローラに予備吐出された処理液とが、  
共通の前記筐体内に貯留されることを特徴とする基板処理装置。

**【請求項 6】**

請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載された基板処理装置であって、  
前記ノズル内部を通して前記ノズルから吐出された洗浄液と、  
基板への処理液の吐出前に前記ノズルから前記ローラに予備吐出された処理液とが、  
共通の前記筐体内に貯留されることを特徴とする基板処理装置。

**【請求項 7】**

請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載された基板処理装置であって、  
前記ノズル洗浄機構から前記ノズルの先端部に向けて吐出された洗浄液と、  
前記ノズル内部を通して前記ノズルから吐出された洗浄液と、  
基板への処理液の吐出前に前記ノズルから前記ローラに予備吐出された処理液とが、  
共通の前記筐体内に貯留されることを特徴とする基板処理装置。

**【請求項 8】**

請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載された基板処理装置であって、  
前記筐体内に貯留して前記洗浄液を含んだ貯留液に前記ローラの下部が浸漬されること  
によって、前記貯留液が前記ローラの洗浄に使用されることを特徴とする基板処理装置。

**【請求項 9】**

請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載された基板処理装置であって、  
前記筐体の内部側面に設置され、前記筐体内に洗浄液を供給する洗浄液供給手段と、  
前記筐体内の液面高さを検知する液面検知手段と、  
前記液面検知手段によって検知された液面レベルが所定の基準レベルを下回ったときに  
、前記洗浄液供給手段から前記筐体内に洗浄液を供給させる洗浄液供給制御手段と、  
をさらに備える基板処理装置。

**【請求項 10】**

請求項 1 ないし 9 のいずれかに記載された基板処理装置であって、  
前記ノズルが前記筐体の内部に下降した状態で、前記ノズルから前記洗浄液の吐出を行  
うことにより、前記ノズルの内部洗浄が行われることを特徴とする基板処理装置。